

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma



Systeme de dépôt de couches minces par évaporation

EVA760



by

allianceconcept

Bâti modulaire et évolutif de grandes dimensions aux performances adaptées à vos procédés

Grâce à son volume, le système EVA760 permet une **large gamme de configurations complexes**.

Cet équipement configurable au même titre que l'ensemble des bâtis de la gamme, peut traiter un grand nombre de substrats par run.

Son système de pompage largement dimensionné garantit un throughput élevé.

Combinaison mesure d'épaisseur optique et mécanique (quartz), IAD, co-évaporation, régulation de pressions partielles, effluvage sont autant de fonctionnalités pouvant être intégrées à votre système.



Caractéristiques générales

Diamètre enceinte :	760 mm
Hauteur :	920 mm
Volume :	520 litres
Vide limite (configuration cryogénique) :	$5 \cdot 10^{-8}$ mbar ^[1]
Capacité machine :	10 x 6"
Uniformité :	< +/- 5% ^[1]
Implantation passe-paroi :	Oui
Pilotage machine :	- Gestion des procédés - Traçabilité

^[1] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

